

(43) 国際公開日
2008年3月6日 (06.03.2008)

PCT

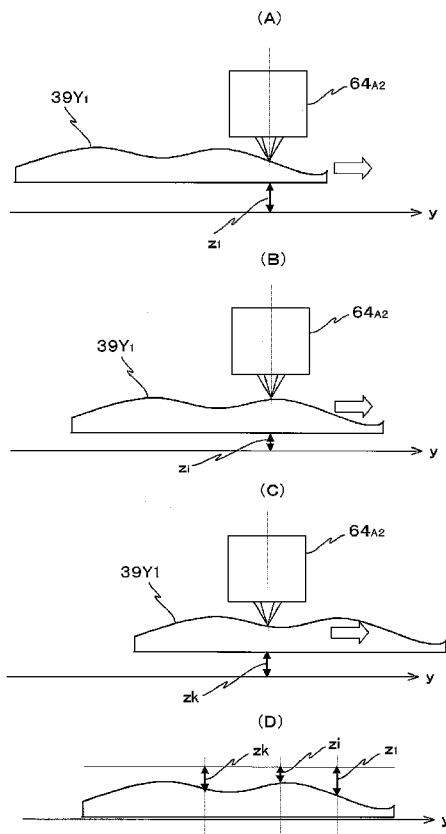
(10) 国際公開番号
WO 2008/026739 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/027 (2006.01) G01B 11/30 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01) G03F 7/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/067063
- (22) 国際出願日: 2007年8月31日 (31.08.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-236975 2006年8月31日 (31.08.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柴崎 祐一 (SHIBAZAKI, Yuichi) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 立石 篤司 (TATEISHI, Atsuji); 〒2060035 東京都多摩市唐木田一丁目5番地9 唐木田センタービル 立石国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

[続葉有]

(54) Title: MOBILE BODY DRIVE METHOD AND MOBILE BODY DRIVE SYSTEM, PATTERN FORMATION METHOD AND APPARATUS, EXPOSURE METHOD AND APPARATUS, AND DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 移動体駆動方法及び移動体駆動システム、パターン形成方法及び装置、露光方法及び装置、並びにデバイス製造方法



(57) Abstract: A drive apparatus drives a wafer stage (WST) in Y-axis direction according to a measured value of an encoder (62A) which measures position information on the wafer stage (WST) in the Y-axis direction and information on a flatness of a scale (39Y₁) measured by the encoder. In this case, the drive apparatus can drive the wafer stage in a predetermined direction according to the measurement value obtained after correcting the measurement error caused by the flatness of the scale contained in the measurement value of the encoder. Accordingly, it is possible to accurately drive the wafer stage in a predetermined direction by using the encoder without being affected by convexes/concaves of the scale.

(57) 要約: 駆動装置により、ウエハステージ (WST) の Y 軸方向の位置情報を計測するエンコーダ (62A) の計測値とそのエンコーダによって計測されるスケール (39Y₁) の平面度に関する情報とに基づいて、ウエハステージ WST が Y 軸方向に駆動される。この場合、駆動装置は、そのエンコーダの計測値に含まれるスケールの平面度に起因する計測誤差をスケールの平面度に関する情報に基づいて補正した補正後の計測値に基づいて、ウエハステージを所定方向に駆動することが可能である。従って、スケールの凹凸に影響を受けることなく、エンコーダを用いてウエハステージを精度良く所定方向に駆動することが可能となる。



IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, 添付公開書類:
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, — 国際調査報告書
ML, MR, NE, SN, TD, TG).